

ХОЛЬЦЛООГҮЙ УСТӨРӨГЧЖУУЛСЭН АМОРФ ЦАХИУРЫН
ДЭЭЖИН ДЭХ ФОТОДАМЖУУЛАЛЫН ТЕМПЕРАТУРЫН
ХАМААРАЛД ДУЛААН БОЛОВСРУУЛАЛТ БА ГЭРЭЛТҮҮ-
ЛЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Д.Батсуурь, Б.Бурмаа, Ж.Даваасамбуу,
П.Алтанцог^a, Ш.Чадраабал^a, А.Г.Казанский^b,
И.Г.Климаншин^b

Устөрөгчийн аморф цахиур /a-Si:H/ нь нарны зай хийхэд тохиromжтой материалын хувьт судлаачдын сонирхолыг ихэд татах болсон юм. Үүнтэй холбогдон нарны элементийн үр ашигтай ажиллагааг тодорхойлдог рекомбинациин процессуудыг судлахад их анхаарч байна. a-Si:H доторхи рекомбинациин үндсэн төв бол зөрөг корреляцийн энерги бүхий тасархай холбоосын загварын дийлэнхий нь a-Si:H-ийн хөдлөх чадварын завсар дахи фотодамжууллын температурын унтраалтыг /ФТУ/ тайлбарлахын тулд дараах загварыг дэвшүүлжээ. Энэ загвар ёсоор тасархай холбоосын концентраци багатай / 10^{17} см⁻³-ээс бага/ дээжинд рекомбинациин хурд нь нүхнүүд валентын бүсийн сүүлийн дулаанаар идэвхжих, дараа нь сорог цэнэгтэй тасархай холбоосон дээр баригдах явдлаар тодорхойллогдог температурын завсар байдаг гэж үзэг /2.3/.

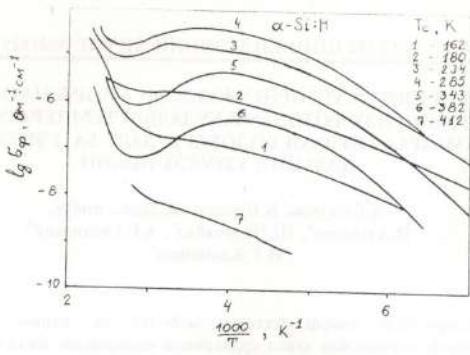
Дефект ихтэй / 10^{17} см⁻³-ээс их/ дээжинд рекомбинациин хурд нь электрон дамжууллын бүсийн сүүлийн саармаг цэнэгтэй тасархай холбоосын төлөвт тунельчээн баригдах процессор тодорхойллогдог /1/. Энэ үед нүх дулаанаар идэвхжих процес фотодамжууллын хэмжээнид нөлөөлөхгүй учир ФТУ ажиглагдах ёсгүй. Энэ загвар хольцлоогүй a-Si:H-ийг удаан хугацаагаар урьдилан гэрэлтүүлэхэд тасархай холбоосын концентраци нэмэгдэж ФТУ дараагдлаг үзэгдлийг тайлбарладаг /4/. Ийм ч уураас хольцлоогүй a-Si:H-д ФТУ илэрч байвал дээжинд тасархай холбоосын концентраци бага байгаагийн гэрч гэж үзэг.

Гэтэл фосфороор хольцласон a-Si:H удаан гэрэлтүүлэхэд ФТУ бий болдог байна /5/. Энэ нь дефектийн концентраци бага байх нь a-Si:H д ФТУ үүсэх пор ганц шалтгаан биш гэдгийг харуулж байна.

Үүнийн бидний саяхан хийсэн a-Si:H дахь рекомбинациин процес суурин температурын үзүүлэх нөлөөг судалсан үр дүн нотолсон юм.

^a-ШУА-ийн ФТХ

^b-Москвагийн УИС



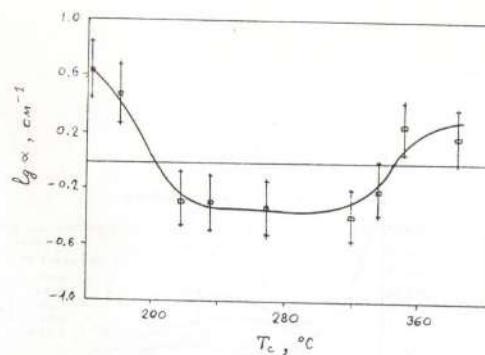
1-р зураг

Суурин өөр өөр температурт суулгасан дээжнүүдийн фотодамжууллын температурын хамаарал

1 ба 2-р зураг дээр суурин температур нь 162-420°C байхад гарган авсан a-Si:H дээжнүүдийн фотодамжууллын температурын хамаарал ба 1,2 эВ энергийтэй фотоны оптик шингэлтийн хэмжилтийг харуулав. Эндээс узхэд 220°C-ээс бага температурт суулгасан дээжийн тасархай холбоосны концентрацii буури, фотодамжуулалт яхт ФТУ хүчтэй болж байгаа. Харин 300°C-д суулгасан дээжийн тасархай холбоосны концентрацii нэмэгдэж, фотодамжуулалт яхт ФТУ-ын гүн нэмэгдэж байгаа нь ийн сонирхолтой баримт бөгөөд түүнийг ФТУ-ын дурьдсан загвараар тайлбарлаа боломжтүү юм.

Нүх тасархай холбоосны тов дээр баригдах процесс рекомбинациин хурдыг тасархай холбоосны ямар ч концентрациин үед тодорхойлдог гэж үзүүлшилтэн эдгээр үр дүнг дараах маягаар тайлбарлаж болно.

Ингэж үзэл суурин температураас хамааран ФТУ ихсэх буюу багасах нь холдлах чадварын заварын доод хагаст оршиж нүх, наалдуулах тов болон тасархай холбоосны концентрацын харьцангуй өөрчлөлтөөр тодорхойлогдох болно. Суурин температур 220°C хүртэл измэгдэхэд ФТУ нэмэгдэх нь тасархай холбоосны концентрацii багасах, магадгүй бас "мэдрэмжит" төвийн концентрацiiхэсэхтэй холбоотой байж болно. 300°C-ээс дээш температурт тасархай холбоосны концентрацii измэгдэж эхлийн фотодамжууллыг бууруулаа. Гэхдээ энэ үед суурин температур нэмэгдэхэд "мэдрэмжит" төвийн концентрацii тасархай холбоосныхоос хурдан ихээдэг гэж үзэл ФТУ гүнзгийрч болно. Бүр их температурт / \$T_c > 400^\circ\text{C}\$ / тасархай холбоосны концентрацii хурдан осч ФТУ-ыг арилгана. Ийм "мэдрэмжит" төвийн үүргийг a-Si:H дотор байдаг орон зайд бие биетэйгээ / 6/ буюу "улзгээл" холыгийт / 7/ шүтгэлэн байрласан тасархай холбоос гүйцэтгэж болох юм.

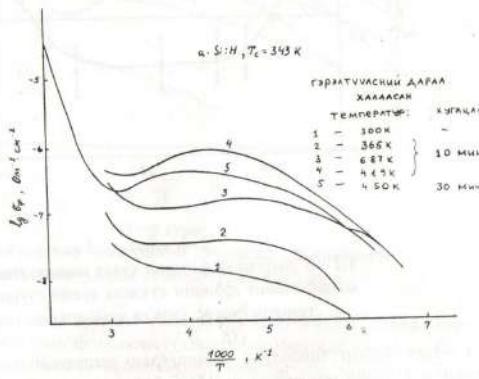


2-р зураг

1,2 эВ энергийтэй фотоны хувьд шингэлтийн коэффициент дээжийн суулгасан температуреас хэрхэн хамаарах нь

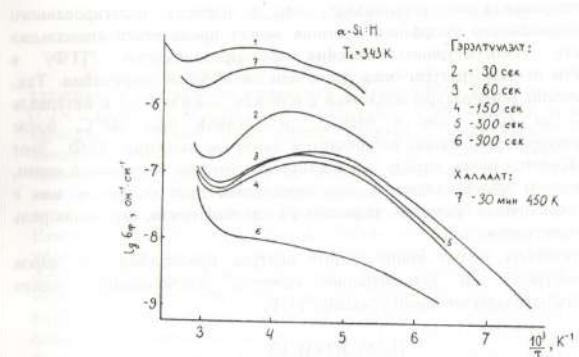
Бид эдгээр тайлбараа лавшируулан шалгахын тулд урьд судалсан дээжнээс суурин температур нь 343°C байхад суулгасан дээжийн соигон авч /8/ дулаан боловсруулалт хийх, урьчилан гэрэлтүүлэх /Стеаблер Воронскийн узгээл/ хоёр нь рекомбинациин процесст хэрхэн нөлөөлдлийн тодруулах түршилт тавьсан юм /3, 4-р зураг/. Дээжийг 10 Торр даралттай вакумд 30 минутын турш 40 Вт-ын вольфрамын лампын гарлийг дулааны шүүлгүүрээр дамжуулан шарж деградацийн оруулсны дараа 365, 419 K температурт тухай бүрт 10 минут халааж дулаан боловсруулалт хийгээд фотодамжууллын температурын хамаарлын хэмжэснийг 3-р зураг дээр харуулав.

Энд мөн түүнчлэн гэрэлтүүлсний дараа халаалгүй шүүд хэмжсэн ба 450 K-д 30 минут дулаан боловсруулалт хийсэн дээжийн фотодамжууллын температурын хамаарлыг харьцуулан үзүүлэв. Дулаан боловсруулалтын температур дээшилхийн хирээр фотодамжуулалын утга нэмэгдэж, ФТУ үссэн цаашид улам улмаар хүчтэй болж байна. Үүний гэрэлтүүлгийн нөлөөгөөр үссэн тасархай холбоос нь рекомбинациин төвийн үүрэг гүйцэтгэж байнаа боловсруулалтын нөлөөгөөр "мэдрэмжит" төв болон хувирч байгаагаар тайлбарлаж болох юм. Бүрэн дулаан боловсруулалт хийсэд /3-р зураг/ муруй 5/ фотодамжуулалт буурч, ФТУ суларч байгаа нь усторогч дээжнээс гарч тасархай холбоосны концентрацii харьцангуйгаар нэмэгдсэнтэй холбоотой байж болно.



3-р зураг

Фотодамжуулалт гэрэлтүүлгийн нөлөөг судлахдаа дээр дурьсан маягаар бүрэн дулаан боловсруулалттай дээжинд фотодамжууллын температурны хамааралыг хэмжэсний дараа / муруй 1/ мон 450 К-д 15 минут халаасны дараа тухай бүр 30, 60, 150, 300, 900 секунд волфрам лампын гэрэээр шаралт хэмжэсний / муруй 2-6/ 4-р зураг дээр узүүлэв. Эндээс харахад гэрэлтүүлэх хугацаа нэмэгдэхэд фотодамжуулал буурах ерөнхий хандлага байхын хамт ФТУ 30 секунд шарсын дараа хамгийн хүчтэй болсноо 60-300 секунд гэрэлтүүлэхэд эргээд буурч мэдэгдэхүүн өөрчлөгдөхгүй байв. Харин 900 секунд шарахад ФТУ бүрмөсөн арилж байна. Эндээс ФТУ-ыг хүчтэй болгодог "мэдрэмжит" төв үүсх процесст гэрэлтүүлгийн эхний үед зонхицлог бөгөөд шарах хугацаа нэмэгдэхэд рекомбинациын төв үүсх явдал давамгайлдаг нь тодорхой байна.



4-р зураг
Өөр өөр хугацаагаар деградацийн оруулсан дээжний фотодамжууллын температурын хамаарал

Эн нь гэрэлтүүлэхэд эхлээд бүтцийн өөрчлөлт гарч, хоорондоо буюу холыгийн шүүгэлэн байрласан дефект үүсч, лараа нь тасархай холбоосны төв бий болдог гэсэн үг юм.

Энэст дүгнэж хэлэхэд бидний судалгааны үр дүн хольцоогүй усторгожуулсан аморф шахинур халсыанд түүний гарган авсан сууриний температурын тодорхой мүжид, эсвэл гэрэлтүүлэх процессын эхний үед фотодамжууллын температурын унтратлал деградацийн процессын нөхөнгоөр хүчтэй болгод нь тасархийн холбоос орон зайд ѿр хоорондоо буюу "үзүүлэгэл" холыгтой шүтэлэн байрласан дефект үзүүгээ тэр нь нүхийн наалдуулагч мэдрэмжит төвийн үүрэг гүйцэтгэж болохыг харуулж байна.

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОСВЕШЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ГАШЕНИЕ ФОТОПРОВОДИ-
МОСТИ В ПЛЁНКАХ НЕЛЕГИРОВАННОГО ГИДРОГЕНИЗИРОВАН-
НОГО АМОРФНОГО КРЕМНИЯ

/резюме/

Экспериментально установлено, что в пленках нелегированного гидрогенизированного аморфного кремния может проявляться аномальная зависимость температурного гашения фотопроводимости /ТГФ/ в зависимости от температуры осаждения или оптической деградации. Так, при увеличении температуры подложки в пленках, осажденных в интервале от 300°C до 400°C или в пленке, осажденной при 340°C, после кратковременной деградации наблюдается заметное усиление ТГФ. Этот факт объясняется нами, наряду с известными центрами оборванных связей, возникновением пространственно корелированных друг с другом или с центрами остаточных примесей, дефектов оборванной связи, играющих роль центров очувствления.

В условиях, когда концентрация центров прилипания для дырок растет быстрее, чем концентрация центров рекомбинации, может происходить наблюдавшееся нами усиление ТГФ.

НОМ ЗОХИОЛ

1. Dersch H., Schweitzer L., Stuke J.,
Phys. Rev. B, 1983, v.28, N.8, p.4678.
2. Morigaki K.
J.Non-Cryst. Sol., 1985, 77 & 78, p.583.
3. McMahon T., Grandall R.
Phys. Rev. B, 1989, v.39, p.1278.
4. Dersch H., Stuke J., Beichler J.
Appl. Phys. Lett., 1981, v.38, p.456.
5. Звягин И.П. Курова И.А. Ормонт Н.Н
Письма в ЖЭТФ, Т.43, Вып. 11, с.528.
6. Vanecek M., Koska J., Stuehnik J., Triska A.
Sol. St. Commun., 1983, v.39, N11, p.1199.
7. Adler D.
Solar cells, 1983, v.9, p.133.
8. Батсуурь Д., Бурмаа Б., Алтанцог П., Чадраабал Ш., Казанский А.Г.
МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 1990. №1.
1/102/, х.1.

МУИС, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ № 2(125), 1996

Уран, торийг тодорхойлох γ-спектрометрийн ага

Ш. Гэрши, Н. Ганбаатар, Ж. Сэрээтэр

1. Оришил

Ураны хүдрийн олборлолт нь далхийн зах зээл дээрх ураны хэрэгцээ ба хангамжкаас хамаарна. Ойрын 10–15 жилийн ураны (U_3O_8) худалдаа аажмараа тохиолтой[1] 1996–2000 онд ураны жилийн хэрэгцээ 35–40 мян. тоинд хүрэх төвлөтэй. Цемийн зөвсэгт хэрэглэхээр ивэцелсэн хагас сая орчим тонн U_3O_8 –тай тэнцүү хэмжээний өндөр баягуулалттай уран (ӨБҮ) –ыг цемийн реакторын түүш болгон хувиргах гэж байна. Энэ нь далхийн нийт ураны хэрэгцээний 25 %-ыг 25 жилийн түрш хангах боломжтой юм. Ураны нийт хэрэгцээг Канад, Австрали, АНУ Намиби, ФАБНУ, Орос, Хятад, Узбекстан зэрэг уран их хэмжээгээр үйлдвэрлэн худалддаг оруууд хангах бөгөөд ураны үйлдвэрлэлийн 5 орчим хувь Бразили, Аргентин, Чех, Энглсх, Монгол, Пакистан, Испанийн жижиг төвүүддэд поогоож байна. Ураны зах зээлийн үндэслэлийн ӨБҮ –ын ихээхэн илөөлөх төвлөтэй. Оросын ӨБҮ –ын АНУ олборлосон урантайгаа холбогч гаргахад 1 кг ураны чадаа 20 \$ болж юм гэж тооцож байна. Харин Европын холбогчны улсуудын цемийн түүшиний асуудлыг эрхэлдэг “Евроатом” Орос, Узбекстан, Казакстан зэрэг улсуудаас авах ураны хэмжээ нийт хэрэгцээний 25% байхаар хязгаар тогтоон үнийн доод хэмжээ 29 \$ байхаар тогтоосон байна. Ийнхүү ойрлын ирээдүйд далхийн зах зээл дээр ураны хангамж тогтвортой, чадаа 20–30 \$/кг байх төвлөтэй.

Манай орчим ураны олборлолтыг нэмэгдүүлэхтэй холбогдон ураны хайгуул шинжилгээ, баяжуулах үйлдвэрийн процессыг хянах хурдан, нарийн аргыг боловсруулсан практиктай извтрүүлэх нь чухал ач холбогдолтой болж байна. Ураны хүдэр, нүүурс, фосфорит зэрэг дээжид уран, торийн хэмжээг тодорхойлох цемийн физикийн арга тухайлбал гамма спектрометрийн аргы боловсруулсан тухай энд бичихээнийг бичиж байна.

2. Хүдэр, нүүрс, фосфорит, хорсний дээжинд
ураны агууллыг тодорхойлох

Байгаль дээр урт настай уран-238 ($T_{1/2} = 4.5 \cdot 10^9$ жил), торий-232 ($T_{1/2} = 1.4 \cdot 10^{10}$ жил), уран-235 ($T_{1/2} = 7 \cdot 10^8$ жил) цацраг идэвхтэй изотопуудаас эх авсан уран, торийн турван бүл хэдийн алфа ба бета задралын дунд хар туталтны тогтвортой изотопууд уүсгэнэ. Заварын цацраг идэвхтэй изотопуудаас гарахаа у-цацрагуудыг хагас дамжуулагч германийн детектор бүхий γ-спектрометр ашиглан бүртгэдэг. 1-р хүчинтэд уран ба торийн булуудийн изотопуудын задралд гарахаа у-цацрагуудыг узүүлэв[2].